

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 20 年 1 月 10 日 (2008.1.10)

【公開番号】特開 2001-203222 (P2001-203222A)
 【公開日】平成 13 年 7 月 27 日 (2001.7.27)
 【出願番号】特願 2000-379426 (P2000-379426)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/52 (2006.01)

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/52 F

H 0 1 L 21/60 3 0 1 K

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 11 月 20 日 (2007.11.20)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 処理ステーションで湾曲した回路基板 (3) を水平に引きよせるとともに押しつける吸引装置を備えたダイボンダあるいはワイヤボンダにおいて、前記吸引装置は、

- 前記回路基板 (3) に対して支持面 (2) を有し、該支持面 (2) の方に向いて開口すると共に可撓性材料から構成された真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) を位置決めしている少なくとも一つのキャビティ (7) を備えるプレート (1) と、

- 前記回路基板 (3) に吸引力をかけるために前記支持面 (2) のレベルよりも上側に前記真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) を上昇させるとともに、前記回路基板 (3) の搬送中は前記キャビティ (7) 内に前記真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) を下降させる手段と、

- 前記真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) と真空源との間に配置され、前記回路基板 (3) の搬送中に閉じて前記真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) に真空をかけないバルブ (12; 13) と、

を備えることを特徴とするダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項 2】 前記真空グリッパ (8.1; 8.2; 8.3; 8.4) は、ペロー型の真空グリッパであることを特徴とする請求項 1 に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項 3】 前記吸引装置は、前記処理ステーションで前記回路基板 (3) の下面に生じる真空を計測するためのセンサをさらに備えていることを特徴とする請求項 1 または 2 に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。

【請求項 4】 前記支持面 (2) は、前記処理ステーションの所定の位置に設けられたグループ (6) と、前記グループ (6) に真空をかけるための穴 (5) とを備え、

前記回路基板 (3) の搬送方向から見たときに、複数の前記キャビティ (7) の少なくとも 1 つが、前記グループ (6) の第 1 の側に設けられ、

複数の前記キャビティ (7) の少なくとも 1 つが、前記グループ (6) の反対側に設けられていることを特徴とする請求項 1 から 3 のいずれか 1 項に記載のダイボンダあるいはワイヤボンダ。